科学研究費助成事業

—

研究成果報告書



	7	μ 成	2	7 年	6	月	24	日現在
機関番号:	1 3 1 0 2							
研究種目:	基盤研究(C)							
研究期間:	2012 ~ 2014							
課題番号:	2 4 5 6 0 0 0 8							
研究課題名	(和文)大気圧プラズマを用いたナノ蛍光体の還元・硫化・窒化処	理と·	その	凝集	抑制	高交	力率化	
研究課題名(英文)Reduction, sulfuration and nitridization of nano-sized phosphor by atmospheric pressure plasma for suppressing agglomeration and improving efficiency								
研究代表者								
加藤有	行(Kato, Ariyuki)							
長岡技術	科学大学・工学(系)研究科(研究院)・准教授							
研究者番	号:10303190							

研究成果の概要(和文):誘導結合型プラズマ(ICP)を用いて,錯体重合法により作製したKSrPO4:Eu蛍光体の還元処 理を行った.水素を混合したバッファーガスを用いたICPを照射することで,還元された2価のEuイオンの発光が著しく 増大した.Euイオンの還元量はバッファーガス中の水素濃度,投入電力,照射時間とともに増大し,水素濃度7%,投入 電力80%,照射時間15分の条件下では、後光が温度は2000年、2000年、100 まで迫る還元量であった.ICP照射直後の試料温度は300 以下であり,ICPは極めて短時間かつ低温で蛍光体中のEuイ オンの還元処理できる方法であることがわかった.

4,300,000円

研究成果の概要(英文):Reduction treatment using inductively coupled plasma (ICP) has been demonstrated for KSrPO4:Eu phosphor synthesized by polymerized complex method. The emission of reduced divalent Eu ions was enhanced significantly by irradiating ICP using hydrogen mixed buffer gas. The amount of reduced Eu ions was increased with increasing hydrogen concentration, input power and irradiation time. Under the conditions of hydrogen concentration of 5%, input power of 80 W and irradiation time of 15 minutes, the amount of reduced Eu ions has been attained one third of that by conventional heating treatment (hydrogen concentration of 5%, 1000C, 3 hours). Temperature of the sample immediately after irradiation was less than 300C. From the result above, ICP was found to be a effective way to reduce the Eu ions in phosphor in very short time at low temperature.

研究分野:光物性物理学

キーワード: 誘導結合型プラズマ 蛍光体 還元処理

交付決定額(研究期間全体):(直接経費)

1版

1.研究開始当初の背景

(1) 近年,ナノ蛍光体は生体内の蛍光標識として医療およびバイオテクノロジーの分野において大きな注目を集めている他,従来の 蛍光体の応用分野であるエレクトロニクス の分野においても,電気泳動堆積法やエアロ ゾルデポジション法のような薄膜成長法の ための原料として利用することが期待され ている.ナノ粒子を得る手法としては,溶液 化した原料を圧力容器内で高温高圧にする ことで,配位能力の高い OH 基を持つ溶媒を キレート剤として,粒子表面に配位させ,粒 子の成長を抑制させるソルボサーマル法の ような液相法が広く用いられている.

(2) 液相法により合成したナノ蛍光体は多 くの場合,表面に OH 基の吸着や残留有機物 の残留があるため、発光効率が極めて低く、 それらの除去のために熱処理が必要となる。 また, 蛍光体の中でも Eu²⁺を発光中心に持つ ものは,その発光強度の高さ,スペクトル幅 の広さ,そして波長制御のしやすさから,極 めて有用な蛍光体であるが, Euを3価から2 価に還元するために水素雰囲気等のもとで 還元処理を行う必要がある.さらに, Eu²⁺を 発光中心に持つものは,母体が硫化物や酸窒 化物であるものが多いので、その場合、硫化 水素やアンモニア雰囲気中での硫化や窒化 処理が必要となる.上記のような熱処理は高 温下で長時間行う必要があるので,ナノ粒子 の再凝集が起こってしまい , ナノ蛍光体とし て利用する際に問題となっていた.

2.研究の目的

(1) 本課題では上記の熱処理による凝集の 問題を解決すべく,反応性プラズマを用いた 処理を行うことを目的とした.典型的な例と してリン酸塩を母体に持つために優れた化 学安定性をもち,照明用として期待されてい る KSrPO4:Eu 蛍光体に対し,H2を導入した誘 導結合型プラズマにより還元処理を試みた.

3.研究の方法

(1) 本課題では当初,誘電体バリア放電によ る大気圧プラズマを用いる予定であったが より定量的な議論をしやすくするために,プ ラズマの均一性に優れる誘導結合型プラズ マ (ICP) を用いることにした.図 1 に本課 題で用いた自作の ICP 装置の概略図を示す. RF 電源 (13.56 MHz, 300 W) は LC マッチン グボックスを介して,石英管に巻きつけたコ イルに接続されている.石英管内に処理する 試料が置かれ,2 台のマスフローコントロー ラーと真空ポンプを用いて,バッファーガス が導入, 排気される. 当初は, 一台のマスフ ローコントローラーのみで, バッファーガス として N₂または H₂(3%)/N₂を切り替えて使用 していたが,後にH2濃度を0%から10%の範囲 で制御するために図1のようにマスフローコ ントローラーを二台に増設した.



図1 本課題で用いた ICP 装置

(2) 構築した ICP 装置を用いて, KSrPO4:Eu 蛍光体に対して還元処理を試みた.還元に用 いる KSrPO₄:Eu(0.4%)前駆体は以下に示す均 ーな組成の微粒子が高い収率で得られる錯 体重合法により作製した.化学的量論比に秤 量されたリン酸二水素カリウム(KH,PO,),炭 酸ストロンチウム (SrCO₃), 酸化ユーロピウ ム (Eu₂0₃) を,希硝酸水溶液に溶解し,金属 イオンの二倍のモル比のクエン酸一水和物 を加え,80 で2時間撹拌することにより, 金属イオンをキレート化させた.クエン酸一 水和物と同モル量のプロピレングリコール を加え,100 で重合反応を起こさせること により,エステル樹脂を得た.得られた樹脂 を 350 で熱分解させ, さらに大気中 800 で3時間仮焼することで, KSrPO₄: Eu 前駆体 を得た.

4.研究成果

(1) バッファーガスとして $H_2(3\%)/N_2$ を 20 sccm の流量で流し,40 Wの投入電力で10分間,ICP を KSrPO4:Eu 前駆体に照射した.図2 に ICP 照射前と照射後の KSrPO4:Eu のPL スペ クトルを示す.ICP 照射により430 nm 付近に ピークを持つ Eu²⁺の発光が約20倍増大した. このことから,KSrPO4中の Eu³⁺は ICP により Eu²⁺に還元することができることがわかった. 一方,620 nm 付近の Eu³⁺による発光は,ICP 照射により減少しないことから,ICP により 還元された Eu³⁺はほんの一部であることがわ かった.

(2) 図3にEu²⁺の発光強度(すなわち還元された Eu³⁺の量)の ICP 照射時間依存性(H₂(3%)/N₂,40 sccm,80 W)を示す.照射後すぐに還元が起こり,15分まではEu²⁺の発光強度が線形的に増加するが,それ以降飽和することがわかる.このことから,ICP を用いると非常に短時間で還元処理ができることがわかった.

 (3) 図 4 に Eu²⁺の発光強度の投入電力依存 性を示す.その他の ICP 照射条件は,バッフ ァーガス H₂(3%)/N₂,ガス流量 40 sccm,照射 時間 15 分である.投入電力が増大するとと もに Eu²⁺の発光強度も増大するが,80 W 以上 になると逆に減少した.この減少の原因につ いては現段階では不明である.



図 2 ICP 照射前と照射後の PL スペクトル



(4) 図 5 にバッファーガス中の水素濃度依存性を変化させたときの Eu²⁺の発光強度の変化を示す.7%までは Eu²⁺の発光強度が増加するが,それ以上の濃度では飽和していることがわかる.このことから,Eu³⁺の還元には,ICP中の水素ラジカルが寄与していると考えられる.一方,バッファーガスの流量を変化させても,Eu²⁺の発光強度はほとんど変化し

なかった.

本課題において最大の Eu²⁺の発光強度 (5) が得られた ICP 照射条件(H₂(7%)/H₂, 40 sccm, 80 W, 15 分) により処理した KSrPO4: Eu と, 従来の電気炉加熱(H₂(5%)/H₂, 1000, 3時 間)により処理した KSrPO₄:Eu の PL スペクト ルを図6に示す.従来法に比べ ICP による処 理では 1/3 程度の Eu²⁺の発光強度しか得られ ず,Eu³⁺の発光も残っている,これは今回用 いた KSrPO₄:Eu 試料は錯体重合法で作製した ため,粒径が1µm以上と,当初,本課題で 処理対象としていたナノ蛍光体粒子に比べ 非常に大きいため,試料の表面付近でしか還 元が起こっていないためと考えられる.また, ICP 照射後の試料の温度は 300 以下であっ たので,ナノ蛍光体粒子に対して ICP を照射 すれば,当初の目的どおり,低温かつ短時間 で凝集を発生させることなく極めて効果的 に還元処理が行えると考えられる.さらに、 KSrPO₄:Eu 以外に,ケイ酸塩蛍光体 Li₂CaSiO₄:Eu, Li₂SrSiO₄:Eu, Li₂BaSiO₄:Euに 対しても ICP 照射により還元が起こることを 確認しており,本課題の手法は,他の多くの Eu 添加酸化物蛍光体について適用範囲を広 げられる可能性があることがわかった.



図 5 Eu²⁺発光の水素濃度依存性



5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔学会発表〕(計5件)

Masuo Takachi, Kohei Yamagami, Kazumasa Takahashi, Toru Sasaki, <u>Takashi</u> <u>Kikuchi</u>, <u>Ariyuki Kato</u>, Reduction Treatment of KSrPO₄:Eu Phosphor by Inductively Coupled Plasma, 8th International Conference on Reactive Plasmas and 31st Symposium on Plasma Processing (ICRP-8/SSP-31), 6P-AM-S06-P16, 2014.

高地満寿夫,山上紘平,高橋一匡,佐々 木徹,<u>菊池崇志</u>,<u>加藤有行</u>,誘導結合プラズ マによる KSrPO₄:Eu 蛍光体の還元処理,第61 回応用物理学会春季学術講演会,18a-PG6-20, 2014.

高地満寿夫,高橋一匡,佐々木徹,<u>菊池</u> <u>崇志</u>,<u>加藤有行</u>,Eu添加蛍光体還元処理のた めの誘導結合プラズマの分光,日本物理学会 新潟支部第43回例会,2014.

高地満寿夫,山上紘平,高橋一匡,佐々 木徹,<u>菊池崇志</u>,<u>加藤有行</u>,誘導結合プラズ マによる Eu 添加 KSrPO₄蛍光体の還元効果の 水素濃度依存性,第 62 回応用物理学会春季 学術講演会,13p-P18-1,2015.

Masuo Takachi, Kohei Yamagami, Kazumasa Takahashi, Toru Sasaki, <u>Takashi</u> <u>Kikuchi</u>, <u>Ariyuki Kato</u>, H₂ Concentration Effect on Reduction Treatment of Eu Doped KSrPO₄ Phosphor by Inductively Coupled Plasma and Its Plasma Spectroscopy, 5th International Symposium on Organic and Inorganic Electronic Materials and Related Nanotechnologies (EM-NANO 2015), P1-86, 2015.

6.研究組織

(1)研究代表者

加藤 有行(KATO, Ariyuki) 長岡技術科学大学・大学院工学研究科 ・准教授 研究者番号:10303190

(2)研究分担者

菊池 崇志(KIKUCHI, Takashi)
長岡技術科学大学・大学院工学研究科・准教授
研究者番号:30375521